

## RFスパッタ装置 SP-3600R



本装置は三台の高周波電源600W(自動整合)を搭載している多元同時スパッタリング用のスパッタ装置です。またサブストレートプラズマクリーニング用の逆スパッタ機構も備えております。排気系は油回転ポンプと磁気軸受型ターボ分子ポンプを採用しており、他のメインポンプに比べてオイルフリーな雰囲気での排気が可能です。カソード部は、3つのターゲットのうち1つは強磁場カソードを採用しておりますので磁性体金属の成膜にも適しております。ガス導入機構・チャンバー加熱機構・公転回転機構・蓋の180℃開閉機構・成膜制御用シャッター機構等成膜に必要な不可欠な機能も装備しております。

### RFスパッタ装置SP-3600R仕様

○到達圧力	5.0×10 <sup>-4</sup> Pa以下 ※常温・脱ガス完了時・液体窒素使用時
○排気速度	9.9×10 <sup>-4</sup> Pa以下迄30分以内 ※常温・脱ガス完了時・液体窒素使用時
○成膜室径	φ460mm×330mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 600W 自動マッチング 3台 逆スパッタ用RF電源 13.56MHz 300W 手動マッチング 1台
○基板形状	3インチ 3枚
○膜厚分布	φ40mmゾーンにて±15%以内
○ターゲット形状	3インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	3
○基板回転	有り
○基板加熱	無し
○真空排気系	油回転ポンプ:240L/min[50Hz] ターボ分子ポンプ:330L/sec
○操作方法	手動
○ガス系統	マスフローコントローラ 1系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相6KVA AC100V単相0.5KVA 冷却水:10L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 寸法: 装置架台本体:1200mmW×850mmD×1635mmH 制御盤:600mmW×600mmD×(1700)mmH